



Echipament: Echipament pentru creștere nanotuburi de carbon și grafene
Nume de catalog: EasyTube 2000
Anul: 2011
Producător: CVD Equipment Corporation, SUA

Domeniu de utilizare:

Echipamentul permite creșterea nanotuburilor de carbon (cu un singur perete și cu pereți multipli, aliniat sau dezordonat) și grafene prin metoda de depunere chimică din fază de vapori (CVD) la temperaturi de operare între 450°C și 1000°C.

Parametri funcționali:

- ➔ Sistem de procesare prin metoda CVD;
- ➔ Dimensiunea substratului: 2”;
- ➔ 4 linii de livrare gaze: gaze reactive (CH_4 și C_2H_4), gaz reducător (H_2) și gaz inert (N_2);
- ➔ Control automat al presiunii;
- ➔ Temperatura de încălzire: max. 1100°C;
- ➔ Încărcare/descărcare rapidă automată a substratului în zona de încălzire;
- ➔ Livrare de precursor lichid la presiune de vapori scăzută;
- ➔ Sistem de ardere a gazelor exhaustate;
- ➔ Sistem de monitorizare și stocare a gazelor inflamabile cu 3 cilindri (H_2 , C_2H_4 , CH_4);
- ➔ Sistem de control computerizat cu monitor și software.



Contact pentru servicii în cadrul PHOENIX:

Mariana Lucaci (mariana.lucaci@icpe-ca.ro)

Adela Băra (adela.bara@icpe-ca.ro)

Tel: 021 346 72 31

Fax: 021 346 82 99

